

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年8月29日(29.08.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/176973 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/004 (2006.01) *B01D 71/64* (2006.01)
B01D 61/14 (2006.01) *G03F 7/16* (2006.01)
B01D 69/00 (2006.01) *G03F 7/20* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/005550
- (22) 国際出願日: 2024年2月16日(16.02.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-027479 2023年2月24日(24.02.2023) JP
- (71) 出願人: 東京応化工業株式会社 (TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.) [JP/JP]; 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 Kanagawa (JP).
- (72) 発明者: 秋山 智(AKIYAMA Satoshi); 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP). 野口 拓也(NOGUCHI Takuya); 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP). 野田 国宏(NODA Kunihiro); 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 田 ▲ 崎 ▼ 聡, 外 (TAZAKI Akira et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT,

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING PURIFIED RESIST COMPOSITION, METHOD FOR FORMING RESIST PATTERN, AND PURIFIED RESIST COMPOSITION

(54) 発明の名称: レジスト組成物精製品の製造方法、レジストパターン形成方法、及びレジスト組成物精製品

(57) Abstract: Disclosed is a method for producing a purified resist composition, the method comprising a step for filtrating a resist composition with a filter that has a porous structure wherein adjacent spherical cells are in communication with each other. The filter is provided with a porous membrane which contains at least one resin that is selected from the group consisting of a polyimide and a polyamide imide. The resist composition contains a metal compound (M) and an organic solvent component (S). The metal compound (M) comprises: a metal ion of a group 3-16 metal atom of the long form periodic table or a metal oxide of the metal atom; and a connector which is connected to the metal ion or the metal oxide. The content of the metal atom contained in the metal ion or the metal oxide is 0.2% by mass to 3% by mass relative to the total mass of the resist composition.

(57) 要約: レジスト組成物を、隣接した球状セル同士が連通した多孔質構造を有するフィルターで濾過する工程を含む、レジスト組成物精製品の製造方法。前記フィルターは、ポリイミド及びポリアミドイミドからなる群より選択される少なくとも一種の樹脂を含有する多孔質膜を備える。前記レジスト組成物は、金属化合物(M)と、有機溶剤成分(S)とを含有する。前記金属化合物(M)は、長周期型周期表における第3族から第16族の金属原子の金属イオン又は前記金属原子の金属酸化物と、前記金属イオン又は前記金属酸化物に結合する結合子とを含む。前記金属イオン又は前記金属酸化物に含まれる前記金属原子の含有量が、前記レジスト組成物の総質量に対して、0.2～3質量%である。

WO 2024/176973 A1

[続葉有]

RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）